

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成22年11月25日 (2010.11.25)

【公表番号】特表2010-507261(P2010-507261A)

【公表日】平成22年3月4日 (2010.3.4)

【年通号数】公開・登録公報2010-009

【出願番号】特願2009-533464(P2009-533464)

【国際特許分類】

H 0 5 K 9/00 (2006.01)

C 0 8 J 7/04 (2006.01)

H 0 1 B 5/14 (2006.01)

H 0 1 B 13/00 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 9/00 V

C 0 8 J 7/04 C F D D

H 0 1 B 5/14 B

H 0 1 B 13/00 5 0 3 D

【手続補正書】

【提出日】平成22年10月4日 (2010.10.4)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ポリマー基材上で第 1 物質をパターニングする方法であって、前記方法が、
凹部領域と、隣接する隆起領域と、を含むレリーフパターンの付いた主要表面を有する
、ポリマーフィルム基材を提供する工程と、

前記ポリマーフィルム基材の前記主要表面上に第 1 物質を堆積させて、コーティングされたポリマーフィルム基材を形成する工程と、

前記コーティングされたポリマーフィルム基材の前記隆起領域の上に機能化材料の層を選択的に形成して、機能化された隆起領域と機能化されていない凹部領域とを形成する工程と、

前記ポリマー基材の機能化されていない凹部領域から前記第 1 物質を選択的にエッチングして、第 1 物質のパターニングされたポリマー基材を形成する工程と、を含み、

ポリマーフィルム基材上で第 1 物質をパターニングする前記方法が、ロールツーロール加工装置を用いて実施され、かつ、第 1 物質を堆積する前記工程が、金属を前記ポリマーフィルム基材上に堆積することを含む、方法。